PRODUCTION OF TRIETHYLENE DIAMINE COMPOUNDS AND PIPERAZINE COMPOUNDS

Publication number: JP5017462
Publication date: 1993-01-26

Inventor: OGAWA TSUKASA; MIZUI NORIMASA;

TATE SHINOBU; KUMOI SADAKATSU

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- International: B01J27/055; B01J27/10; B01J29/06;

C07B43/00; C07B61/00; C07D295/02; C07D487/18; C07B61/00; B01J27/053; B01J27/06; B01J29/00; C07B43/00; C07B61/00; C07D295/00; C07D487/00; C07B61/00; (IPC1-7); B01J27/055; B01J27/10; B01J29/06; C07B43/00; C07B61/00; C07D295/02; C07D487/18

- European:

Application number: JP19910187082 19910702
Priority number(s): JP19910187082 19910702

Report a data error here

Abstract of JP5017462

PURPOSE:To produce the subject compounds in high selectivity and in good yields by treating an amine compound in the presence of a crystalline aluminosilicate catalyst carrying an inorganic salt. CONSTITUTION:An amine compound having a group of the formula (R<1>-R<4> are H, 1-3C alkyl) is treated at 250-450 deg.C in the presence of a crystalline aluminosilicate catalyst which carries an inorganic salt (e.g. sodium sulfate) and which has a silica/alumina molar ratio of >=12/1, preferably (40-5000)/1 to produce the objective compound. The carrying treatment of the inorganic salt on the crystalline aluminosilicate can be performed e.g. by a method comprising impregnating the powder or molded product of the aluminosilicate with the inorganic salt or mixing the powder of the aluminosilicate with the powder of the inorganic salt when molded, before or after the calcination of the catalyst.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本図特新庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出級公開番号 特開平5-17462

(43) 公獺日 平成5年(1988) 1 月26日

	識別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
295/02	A	6791-4C		
27/055	X	6750-4G		
27/10	X	6750-4G		
29/00	x	6750-4G		
43/00		7419-4H		
			審查請求 未請求	: 請求項の数1(全 5 頁) 最終頁に続く
#: #:	特徽平3-187062		(71)出額人	000003300
				東ソー株式会社
(22) 出鞭日	平成3年(1991)7月	12 FI		山口果新南陽市開成町4560番地
			(72)発明者	小川 剛
				山口果新南陽市宮の前2丁目3番35号
			(72)発明者	水井 規雅
				山口県徳山市大字上村564番地
			(72) 発明者	館 思
				山口県下松市大学末武上1018-1番地
			(72) 発明者	業井 貞勝
				山口裏光市虹ケ丘6丁目11番28号

	27/10 29/00	295/62 A 27/655 X 27/10 X 29/06 X 43/00 X	295/02 A 6701-4C 27/955 X 6750-4G 27/105 X 8759-4G 29/96 X 6750-4G 43/90 7419-4H	295/02 A 6791-4C 27/955 X 6750-4G 27/10 X 6750-4G 29/08 X 6750-4G 43/00 7419-4H 著在辦求 未說求 号 快顯平3-187082 (71)出頭人 平成 3 年(1991) 7 月 2 日 (72)発明者 (72)発明者

(54) 【発明の名称】 トリエチレンジアミン類及びピペラジン類の製法

(57) [經納]

[目的] トリエチレンジアミン類及びピペラジン類を高 収率に製造する方法を提供する。

【構成】無機塩が担持された、アルミナに対するシリカ のモル比12以上の結晶性アルミノシリケート触媒の存 在下,分子内に一般式(1)

[(h)1]

『式中、R:~R:はそれぞれ水素原子あるいは炭素数 1~3のアルギル基を示す。〕で表される基を有するア ミン化合物を反応させることによりトリエチレンジアミ ン領及びビベラジン額を奪収率に得ることができる。

[特許納式の新開]

【請求項1】分子内に一般式(1)

E49:13

「式中、 R 1 ~ R 4 はそれぞれ水素原子あるいは炭素数 ミン化合物を、養機塩が損物された、アルミナに対する シリカのモル比12以上の結晶性アルミノシリケート触 縦のな存下で形式させることを特徴とするトリエチレン ジアミン領及びピペラジン類の製法。

「発明の詳細な説明】

[0001]

[産業上の利用分断] 本発明は、トリエチレンジアミン 額及びピペラジン類を高収率に製造するための触媒の改 良技術に関する。

[0002]

「従来の技術」アミン化会物を現化することにより、ト リエチレンジアミンを製造することのできる触媒とし T. ゼオライトが分割である。例えば、A型ゼオライト を触媒として用い、N-(2-アミノエチル) ピベラジ ンを順斜とする製造法 (特開昭50~58096号公 報), 少なくとも、アルミナに対するシリカのモル比2 ODI上の組成比から成る高シリカゼオライトを触媒とし て用い、N-(2-アミノエチル) ピペラジン、N-(2-ヒドロキシエテル) ピペラジンを原料とする製造 するシリカのモル比が1.2以上の結晶性アルミノシリケ ートを斡提として用い、モノエタノールアミンやエチレ ンジアミン等のエチレンアミン類を順斜とする製造法 (特別昭62-228079号公報, 特開昭63-12 2654号公報)、ペンタシル側ゼオライトを触媒とし て用い、ピペラジン、エチレンジアミン、ジエチレント リアミン、2-アミノエタノールを原料とする製造法 (特觸平1-132587号公報、特閱平1-1438 64号公報)が関示されている。

イトは、通常空気雰囲気下600℃以下の温度で構成処 翔されたものが触媒として使用されている。これらの触 媒系で原料アミン化合物を高級化率に反応させた場合、 議ましくない分解反応、縮合反応等の副反応のためトリ エチレンジアミン、特にピペラジンの選択率が低下する という欠点を有している。特謝昭50~58096号公 報では、N-(2-アミノエチル) ビベラジン転化率8 0%のときトリエチレンジアミン選択率55%、転化率 84%のとき選択率45%と低下している。即ち、原料 転化率が高くなるとともに、目的物の選択率が更なる低 50

下傾向を示している。特觸昭60-260574号公報 では、N- (2-ヒドロキシエチル) ピペラジン転化率 21%のときトリエチレンジアミン選択率75%、ビベ ラジン選択率1.7%、転化率7.2%のときトリエチレン ジアミン選択率70%、ピペラジン選択率16%と顕著 な低下はないが、反応温度が極めて高く、触媒活性が著 しく低い。N- (2-アミノエチル) ピペラジン原料の 場合はトリエチレンジアミン選択率が50%以下と低 い。特開昭63-122654号公報では、モノエタノ 1~3のアルキル基を示す。1で表される基を有するア 10 ールアミン転化率86%のときトリエチレンジアミン選 択率79%、転化率100%のとき選択率53%まで低 下する。特別平1-143864号公報では、ジエチレ ントリアミン転化率??%のときトリエデレンジアミン 選択率35%、ピペラジン選択率32%、転化率99% のときトリエチレンジアミン選択率37%。 ピペラジン 選択率24%とピペラジンの選択率が低下している。 [0004]

【発明が解決しようとする機器】 上紀のようにトリエチ レンジアミンの製造に用いられる触媒は、顕常空気等距 20 気下600で以下の温度で推成処理された結晶性アルミ ノシリケートであって、これらの一般的な嫌成条件で処 理された触線をトリエチレンジアミンやピベラジンの製 造触媒として供した場合、以下のような問題点を有す る。①原料転化率を高くすると、トリエチレンジアミ ン、ピペラジンの選択率が低下傾向にある。原料転化率 を高くしても、トリエチレンジアミン、ピペラジンの選 択率が低下しない系においては、目的とするトリエテレ ンジアミン選択率の絶対値が低い。 ②原料転化率を90 %以上にし、原料を回収しないプロセスを考えた場合、 法 (終期昭60-260574号公報)、アルミナに対 30 上紀触媒系では、トリエチレンジアミン、ピペラジンの 選択率が各れも鎌足するに足る十分な値が達成されてい ない。このようなことから、高活性で、尚且つ、高転化

[0005]

【糠額を解決するための手段】 本発明者らは、トリエチ レンジアミン製及びピペラジン類の製造法を鋭意検討し た結果、該反応において、無機塩が担持された結晶性ア ルミノシリケートが触媒として高活性であり、尚且つ、 【0003】これらの既知文献に記載されているゼオラ 40 高転化率においてもトリエチレンジアミン類及びピペラ ジン蟹を高漢根的に製造しうるという新規な事実を見出 だし、本発明を完成するに至った。

率においてもトリエチレンジアミン、ピペラジンを高速

択的に製造しうる触媒が切留されている。

【0006】 肌ち本発明は、無機塩を初待させた結晶性 アルミノシリケートを触媒とし、分子内に一般式(1) [0007]

[4:2]

「式中、R:~R(はそれぞれ水素原子あるいは炭素数 1~3のアルキル基を示す。〕で表される基を有するア ミン化合物を原料とするトリエチレンジアミン類及びビ ベラジン類の製法を提供するものである。

【0008】以下に、本発明を更に詳しく説明する。

[0009] 本発明の方法において触媒として用いる結 晶性アルミノシリケートは、アルミナに対するシリカの モル比12以上、好ましくは40~5000のものであ る。ここで、アルミナに対するシリカのモル比が12米 満のものであると、トリエチレンジアミン類の選択率が 低下し好ましくない。また、アルミナに対するシリカの モル比が5000以上であると、触媒活性がかなり低下 するため奥用的でない。

【0010】本発明の方法における結晶性アルミノシリ ケートは、アルミナに対するシリカのモル比が上述の条 20 件を遊たせば立く時に制御はないが、粉楽10個際の主 空間を有するものが好ましい。このような結晶性アルミ ノシリケートの具体例としては、米国特許第3、70 2, 886号に記載されているZSM-5, ※鋼特許第 1. 334. 243号に記載されているZSM-8、米 国特許第3、709,979号に記載されているZSM --11、米国特許第3,832,449号に記載されて いる Z S M - 12、米国特許第4、001, 346号に 紀載されているZSM-21等がある。

- 【00 11】本発明の方法においては、水熱合成により 30 物であればよく、様々なものがあげられる。例えばモノ 納路性アルミノシリケートを生成する際に、有機結晶化 剤の存在下、非存在下のいずれで水熱合成しても良い。
- 【0012】本発明の方法においては、結晶性アルミノ シリケートは、日型に拠定されず、水素イオンの一部も しくは全部が他の脳イオン、何えばリチウムイオン、ナ トリウムイオン、セシウムイオン、カリウムイオン、マ グネシウムイオン、カルシウムイオン、ランタンイオン 等で交換されたものでも一向に落支えない。
- 【0013】本発明の方法においては、触媒は無機塩が 担持された結晶性アルミノシリケートであり、結晶性ア 40 っても被相で行っても良い。 ルミノシリケートへの無機塩の担持処理は焼成前、ある いは締成後のいずれで行っても良い。無機塩の担持は、 粉末あるいは成剤品へ含凝するか、あるいは成熟時に粉 まの主主得合する等の方法で行うことができ、無機塩の 担持力法は、特に限定されるものではない。
- [0 0 1 4] 本発明において損持される無機塩は、アル カリ金属又はアルカリ土類金属の塩化物、硫酸塩、硝酸 - 東又はリン酸塩等であるが、好ましくは、アルカリ土類 金属よりもアルカリ金属の方が良い。無機塩の粗特量 は、結晶性アルミノシリケートの細額、アルミナに対す 30 の量で使用できるが、通常はアミン化合物/希釈剤のモ

るシリカのモル比等により異なるが、適常、2~50w t%、好ましくは、5~30wt%の範囲で組持すれば らい、科特量が2wt%未満であると、無機塩を招待処 輝した効果が小さく、目的物であるトリエチレンジアミ ン、ピペラジンへの選択率が低い。また、排持量が50 w t %を越えると、触媒活性がかなり低下するため実用 的でない。

【0015】本発明の方法においては、触媒の焼成は、 空気雰囲気下で行っても、水蒸気雰囲気下で行っても良

10 い。焼成条件は、結晶性アルミノシリケートの種類、ア ルミナに対するシリカのモル比等により異なるが、進 常、500~900℃、好ましくは、550~850℃ の温度で、1時間以上、好ましくは3時間以上機成処理 すれば食い。権成器者が500℃未満であると、目的物 であるトリエチレンジアミン類、ピペラジン類の選択率 が低下する。また、焼成温度が900℃以上であると、 結晶性アルミノシリケートの結晶性が低下し、比表面積 が小さくなり、機謀活性が低下する。

[0016] 本発明の方法においては、触媒の形状に制 際はなく、反応形式に応じて粉末のまま、あるいは成型 して用いられる。例えば、懸漢床では粉末、顆粒状で用 いられ、固定床ではタブレット状、ビーズ状、棒柱状に 成型して用いられる。

[0017] 触媒の成型方法としては、例えば押し出し 成型法、打錠成型法、顆粒成型法等があり、成型する際 にはシリカ、アルミナ、シリカーアルミナ、粘土等を粘 結剤として加えても良い。

[0018] 本発明の方法に用いる原料化合物は、分子 内に前紀一般式(I)で表される基を有するアミン化台

エタノールアミン、ジエタノールアミン、イソプロパノ ールアミン、ジイソプロパノ…ルアミン、N… (2-ア ミノエチル) エタノールアミン、N- (2-ヒドロキシ エチル) ピベラジン、N、N '-ピス (2-ヒドロキシ エチル) ピペラジン、N- (2-アミノエチル) ピベラ ジン、N. N ~ - ピス (2 - アミノエテル) ピペラジ ン、ピペラジン、エチレンジアミン、ジエチレントリア ミンあるいはトリエチレンテトラミン等である。

[0019] 本発明の方法においては、反応は気相で行

【0020】本発明の方法においては、反応は膨濁床に よる回分、半回分、連続式でも、また固定床流通式でも 実施できるが、工業的には、固定床流過式が操作。装 置、経済性の面から有利である。

【0021】本発明の方法においては、常叙剤として窒 素ガス、水素ガス、アンモニアガス、水薬気、炭化水率 等の不括性ガス、あるいは水や不活性な炭化水素等の不 話性溶媒を用いて、原料であるアミン化合物を希釈し、 反応を進行させることができる。これらの希釈剤は任意

(4)

ル比は0、01~1とすべきである。モル比0、01以 下ではトリエチレンジアミン類、ビペラジン類の生産性 が低く実用的ではない。また、モル比1以上ではトリエ チレンジアミン翁、ビベラジン総への選択性が低下す 8.

【0022】アミン化合物の反応は、アミン化合物を上 述の結晶性アルミノシリケートから成る触媒と接触させ ることにより進行し、この際の反応温度、空間速度等の 条件は結晶性アルミノシリケートの種類、アミン化合物 の種類により異なり、一義的に決められないが、通常は 10 【0032】実施例1 反応温度250~450℃、空間速度(GHSV)10 0~10000hr-'の範囲で選定すればよい。

「00231本発明の方法においては、通常大気圧下で 存むを行えばよいが、加圧下、減圧下で行うこともでき

[0024] 本発明の方法で用いる触媒は、反応に供す ることにより活性低下を招いたとしても、適時、再生の ための徳成様作を行うことにより、高活性の触媒として 繰り収し使用することができる。

[0025]

[実施例] 以下、本発明を具体的に実施例にて説明する が本発明はこれら実施例にのみ特に設定されるものでは 7263.

[0026] 無線製造網1

粉末25M-5整ゼオライト (東ソー(株) 数860N HA、シリカ/アルミナモル比72) に23. 1wt% の硫酸ナトリウムを含浸させた。その後、打錠成型し、 **空気業開気下650℃、4時開焼成し、ZSM-5** (1) を得た。

[0027] 触媒製造例2

触媒製造例1において、硫酸ナトリウムの含役量を9、 1wt%に変えてZSM-5(2)を得た。

[0028] 触媒製造例3

輪線製造網1において、9.1wt%の塩化ナトリウム を含得させたこと以外は無線製造部1と開機な操作を行 い、スSM-5 (3) を得た。

[0029] 触媒製造例4

触媒製造例1において、26、9wt%の硫酸カリウム を含彩させたこと以外は触媒製造例1と同様な操作を行 い、 ZSM-5 (4) を得た。

粉末28M-5型ゼオライト (東ソー (株) 製860N

HA、シリカ/アルミナモル比72) に9、1wt%の 磁糖ナトリウムを粉末状で均一に混合し、打能成準し た。その後、空気雰囲気下650℃、4時間維成し、Z SM-5(5)を得た。

[0031] 触線製造例6

粉末25M-5型ゼオライト (東ソー (株) 製860N HA、シリカ/アルミナモル比72) を打解成型し、空 気容開気下650℃、4時間維成し、ZSM-5(6) を得た。

協定床流通式反応管に、触媒製造例1で得られた日型2 SM-5 (1) を充填し、温度を350℃に維持しなが ら、N-- (2-アミノエチル) ピペラジンと水との混合 物(N-(2-アミノエチル) ピペラジン/水(モル 比) =5/95) をGHSV1000hr-1にて供給 した。反応液をガスクロマトグラフィーで分析した結 果、原料の転化率64、8%、トリエチレンジアミンの 選択率51、4%、ピペラジンの選択率35.0%であ った。

20 [0033]実施例2

反応温度を370℃に代えた以外、実施例1と関係な操 作で反応させた。その結果、原料の転化率97、4%。 トリエチレンジアミンの選択率62、4%。ピペラジン の選択率26.2%であった。

[0034]実施例3~10

触媒としてZSM-5(2)~(5)を用い、反応温度 を表1のように変えた以外、実施例1と同様な操作で反 応を実施した。その結果を表しに示した。

[0035] 実施例11

30 原料アミンとして、トリエチレンテトラミンを用い、反 病温度を380℃に変えた以外、実施例!と阿様な操作 で反広を実施した。その結果を表1に示した。

[0036] 比較例1,2

輸媒としてZSM-5(6)を用い、反応温度を表1の ように変えた以外、実施例1と同様な操作で反応を実施 した。その結果を表しに示した。

[0037] 比較例3

輸線としてZSM-5(6)を用い、反応温度を365 ℃に変えた以外、実施例11と同様な操作で反応を実施

40 した。その結果を表しに示した。

(表 1]

PM	験課 原料アミ		敲度	転化率	遊択率 (%)		
			(%)	(%)	т	Р	T + P
英施門3	(2)	AEP	365	83. 2	£0. S	31.8	92.5
東施門 4	(2)	AEP	370	184.0	€3.8	19. 5	83.3
実施例 5	(8)	AEP	370	91, 2	60.9	28.8	87. 2
実施例 6	(3)	AEP	390	9T. 5	\$2.7	11. 8	84.3
夹拖例 7	(4)	AEP	350	11.1	59, 8	35. 6	\$5. 8
実施例 8	(4)	AEP	370	109,0	83. 2	25. 9	89.1
実施例 9	(5)	AEP	330	13. 4	54.4	29. 3	£3. 7
実施例10	(5)	AEP	350	\$1.4	82.8	23. 9	\$6.2
実施例11	(1)	TETA	380	180.0	58.5	27, 2	80.7
比較例1	(6)	AEP	355	86, D	61. 9	21. 2	85, 1
比較例 2	(6)	AEP	380	39. 6	64, 5	15.8	86.3
比較例 3	(6)	TETA	365	194, 0	54. 1	10.5	14.8

AEP : N- (2-アミノエチル) ピペラジン TETA: トリエチレンテトラミン

フロントページの続き

(51) In t. Cl.*	識別記号	广内整理番号	F I	技術表示簡例
C 0 7 D 487/18		7019-4C		
// C B 7 B 61/00	3 0 0			